

化学工学会 材料・界面部会 共通基盤技術シンポジウム2016 報告書
実行委員 稲澤 晋、井上 元、菰田 悦之、脇原 徹、田巻 孝敬(文責)

化学工学会 材料・界面部会 共通基盤技術シンポジウム2016が2016年1月14日(木)に東京工業大学にて開催された。本シンポジウムは各種材料プロセスを横断するような共通課題(基盤技術)について議論する場を提供し、基盤技術の体系化を図るとともに、学会と産業界との連携を図ることを目的としたものである。今年度は、微粒子・ナノ材料の分散技術から、塗布乾燥プロセス・デバイス作製までを一連のトピックとして取り上げ、基礎現象の理解からデバイス作製の応用展開までを俯瞰的に捉え直して、広い分野に共通する基盤技術について議論した。昨年度に引き続き企業からの参加者を積極的に募るとともに、関連学会での告知も行った結果、事前登録が174名(当日参加167名)という盛会となった。具体的には、企業から57社(83名)、大学から20研究室(84名)の参加があった。発表の詳細は補足資料のシンポジウム案内をご参照頂きたい。また、シンポジウム後の交流会も70名近くの参加者があり、活発な意見交換がなされていた。今後も、産学連携や分野を越えた交流の場として、共通基盤技術シンポジウムを継続的に開催することが望まれる。



補足資料 化学工学会 材料・界面部会 共通基盤技術シンポジウム 2016
～ 微粒子の分散、塗布乾燥、デバイス作製 ～

主 催 : 化学工学会 材料・界面部会
日 時 : 2016年1月14日(木) 12時45分～17時50分 (開場 12時30分)
会 場 : 東京工業大学 大岡山キャンパス 大岡山西5号館 3F W531(レクチャーシアター)
東急目黒線・大井町線 大岡山駅 徒歩1分 (正門)
案内図 <http://www.titech.ac.jp/maps/index.html>
参加費: 一般、部会員ともに無料
懇親会費: 一般、部会員共に3,000円

材料界面部会では各種材料プロセスを横断するような共通課題(基盤技術)について議論する場を、継続的に提供しています。その議論の中から、各研究・技術における共通性を見だし、学会と産業界との連携を図り、基盤技術の体系化を図ることを目指しています。今年度は、微粒子・ナノ材料の分散技術から、塗布乾燥プロセス・デバイス作製までを一連のトピックとして取り上げます。基礎現象の理解からデバイス作製の応用展開までを俯瞰的に捉え直して、広い分野に共通する基盤技術について議論をします。奮って、お申し込みいただきますようお願いを申し上げます。

プログラム:

12:45～12:50 開会の挨拶

材料・界面部会長 東京工業大学 山口 猛央 氏

12:50～13:30 「微粒子の材質と分散媒の組み合わせに応じた表面修飾と分散制御技術」

横浜国立大学 飯島 志行 氏

13:30～14:10 「メディアフリー新規分散装置 ―高生産性とソフト分散の可能性を秘めたジェットペースター」

日本スピンドル製造(株) 浅見 圭一 氏

14:10～14:50 「濃厚系スラリーの粒子集合状態評価とその応用」

法政大学 森 隆昌 氏

休憩 (14:50-15:00)

15:00～15:40 「選択波長赤外線による塗布膜乾燥プロセスの効率化」

日本ガイシ(株) 近藤 良夫 氏

15:40～16:20 「固体高分子形燃料電池における電極触媒層塗布乾燥過程の輸送現象解明と構造制御に向けた取り組み」

大阪大学 津島 将司 氏、鈴木 崇弘 氏

休憩 (16:20～16:30)

16:30～17:10 「固体高分子形燃料電池用アイオノマーの分散・薄膜凝集状態解析の取り組み」

技術研究組合 FC-Cubic 大平 昭博 氏

17:10～17:50 「リチウムイオン二次電池の最新動向と電極作製工程における課題」

産業技術総合研究所 倉谷 健太郎 氏、小林 弘典 氏、神戸大学 菰田 悦之 氏

懇親会(18:00～19:30) 場所: 大岡山キャンパス 食堂棟2階 コミュニケーション・ラウンジ